

01;02;04;07

© 1994 г.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ОДНОРОДНОСТИ АКТИВНОЙ СРЕДЫ КОРОТКОВОЛНОВОГО ЛАЗЕРА ПРИ ПОМОЩИ ЛЕГИРОВАНИЯ

М.Л.Шматов

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе,

194021, Санкт-Петербург

(Поступило в Редакцию 7 декабря 1993 г.)

Предложено легирование активной среды коротковолнового лазера, вызывающее за счет радиационных потерь сверхлинейную зависимость скорости охлаждения от электронной температуры T_e . Приведена иллюстрационная модель, в рамках которой такое легирование позволяет снизить продольную неоднородность T_e , обусловленную неоднородностью потока излучения накачки. Стабилизирующее влияние радиационных потерь на продольную однородность активной среды рассмотрено в качестве возможной причины, обеспечивающей усиление излучения на $4d-4p$ -переходах кобальтоподобных ионов. Предложена реализация бегущей волны инверсии при помощи модулированного легирования активной среды.

Введение

Неоднородность сфокусированного в линию потока излучения приводит к продольной неоднородности плазменного столба, создаваемого при воздействии этого излучения на твердотельную мишень (см., например, [1–11]). В ряде случаев основное проявление продольной неоднородности плазмы, используемой в качестве активной среды коротковолнового лазера, состоит в рассогласовании усиления в областях с различными значениями продольной координаты x [2–5, 7–10] (см. рисунок). Для подавления этого эффекта в экспериментах применяются системы фокусировки излучения накачки, сконструированные с целью усреднения неоднородности его начального потока (см., например, [4, 5, 7, 9, 10]). В данной работе в качестве дополнительной меры предложено легирование активной среды, вызывающее за счет радиационных потерь сверхлинейную зависимость скорости охлаждения от электронной температуры T_e . Ниже рассмотрена иллюстрационная модель,

рамках которой такой метод позволяет улучшить однородность. Согласно этой модели, легирование приводит к улучшению однородности также в том случае, когда сверхлинейная зависимость скорости охлаждения от T_e достигается и в его отсутствие.

Иллюстрационная модель

Ограничимся рассмотрением узкой области активной среды, соответствующей наибольшему (для данной координаты x) коэффициенту усиления (см. рисунок). Полагаем, что в пределах этой области T_e зависит только от x и времени t . Используем обозначение I_p для значений интенсивности, которые соответствовали бы плоскости XY при отсутствии самой мишени (см. рисунок). Будем отсчитывать время от момента начала облучения мишени. Полагаем, что

$$T_e(x, t < 0) = 0, \quad (1)$$

при $t \geq 0$ значение T_e определяется уравнением

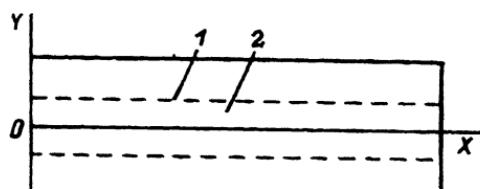
$$\frac{dT_e(x, t)}{dt} = a[I(x, t)] - b[T_e(x, t)] - cf[T_e(x, t)]. \quad (2)$$

Здесь обозначение T_e используется применительно к рассматриваемой области; функция a описывает нагрев образующейся плазмы, при этом полагается, что вместо $I_p(x, y, t)$ можно ввести функцию $I(x, t)$, которая представляет, например, максимальное по y значение I_p . При увеличении I функция a , очевидно, возрастает. Функции b и f характеризуют охлаждение плазмы; f соответствует влиянию легирующей примеси, содержание которой описывается величинами c , $b(T_e = 0) = 0$, $f(T_e = 0) = 0$. Уравнение (2) не учитывает разлет плазмы, т.е. соответствует так называемой "нульмерной" модели [12]. Пренебрежение переносом тепла в продольном направлении оправдано в ситуации, когда величина dT_e/dx достаточно мала, что фактически означает достаточную малость dI/dx .

Введем для количественного описания неоднородности T_e параметр K , определяемый выражением

$$K = (T_{\max} - T_{\min}) / T_{\min}, \quad (3)$$

где T_{\max} и T_{\min} — максимальное и минимальное значение T_e в некоторый момент времени. При использовании этого параметра для сравнения неоднородности различных сред необходимо наложить дополнительное условие, устанавливающее соответствие между моментами определения K .



Расположение осей используемой системы координат.

1 — поверхность мишени (плоскость XY),
2 — проекция основной усиливающей области на плоскость XY.

Рассмотрим стадию нагрева плазмы в ситуации, когда поток излучения накачки воспроизводим и все различие между плазменными столбами состоит в содержании легирующей примеси. Полагаем, что

$$I(x, t \geq 0) = I(x), \quad (4)$$

при этом $\min[I(x)] \equiv I_1$ соответствует продольной координате x_1 , $\max[I(x)] \equiv I_2$ — продольной координате x_2 . Обозначим $T_e(x_1, t)$ через T_1 , $T_e(x_2, t)$ — через T_2 . В качестве дополнительного условия используем равенство

$$T_1 = T_1^*, \quad (5)$$

где T_1^* — произвольно выбранное допустимое значение T_1 .

Момент времени, соответствующий выполнению (5), обозначим через t_1 . Полагаем, что c равняется некоторой величине c_0 ; во всем рассматриваемом диапазоне T_e функции f и $(b + c_0 f)$ зависят от T_e сверхлинейно, т.е. их вторые производные по T_e положительны. Для коэффициента $s > 1$ при сохранении sT_e в этом диапазоне выполняются соотношения

$$f(sT_e) > sf(T_e), \quad (6)$$

$$b(sT_e) + c_0 f(sT_e) > s[b(T_e) + c_0 f(T_e)]. \quad (7)$$

Введем обозначение $T_2^* \equiv T_2[t = t_1(c = c_0)]$ и определим параметр $t_2 = t_2(c)$ как время, соответствующее выполнению условия $T_2(t = t_2) = T_2^*$ при произвольном значении c . Обозначим $(t_1 - t_2)$ через $F(c)$, T_2^*/T_1^* — через r . Согласно (1), (2), (4),

$$F(c) = \int_0^{T_1^*} g(c, T') dT', \quad (8)$$

где

$$g(c, T') = \frac{1}{a(I_1) - b(T') - cf(T')} - \frac{r}{a(I_2) - b(rT') - cf(rT')}. \quad (9)$$

Из определений следует, что

$$F(c = c_0) = 0. \quad (10)$$

В интервале от 0 до T_1^* хотя бы при одном значении T' , которое обозначим через T_a , выполняется равенство $g(c_0, T_a) = 0$. Продифференцировав (9), можно показать, что при $T' = T_a$ производная $dg(c_0, T')/dT'$ отрицательна. Таким образом, значение T_a (в интервале от 0 до T_1^*) единственno,

$$g(c_0, 0 < T' < T_a) > 0, \quad (11)$$

$$g(c_0, T_a < T' < T_1^*) < 0. \quad (12)$$

Из условия (6) следует, что

$$\frac{dF(c)}{dc} < \int_0^{T_1^*} g(c, T') f(T') g_1(c, T') dT', \quad (13)$$

где

$$g_1(c, T') = \frac{1}{a(I_1) - b(T') - cf(T')} + \frac{r}{a(I_2) - b(rT') - cf(rT')}. \quad (14)$$

Произведение $f(T')g_1(c_0, T')$ положительно, при увеличении T' оно возрастает (см. (6), (7), (14)). Поэтому, как легко показать из (8), (10)–(12), при $c = c_0$ правая часть формулы (13) отрицательна. В результате, как видно из (10), при $c > c_0$ имеет место неравенство $f_2(c) > t_1(c)$, что означает $T_2(t = t_1) < T_2^*$. Таким образом, при увеличении c параметр K уменьшается (см. (3), (5)).

Если зависимость скорости охлаждения от T_e сверхлинейна, после прекращения действия излучения накачки однородность T_e будет улучшаться. Это следует из подстановки $I(x, t) = 0$ в (2). Полагая, что $T_2 > T_1$ и выполняется условие вида (7), получаем $d(T_2/T_1)/dt < 0$.

Радиационные потери активных сред коротковолновых лазеров

При выполнении условий $n_e \lesssim 10^{22} \text{ см}^{-3}$, $\bar{z} \gtrsim 10$, $T_e \gtrsim 10^2 \text{ эВ}$, где n_e — концентрация электронов, \bar{z} — средний заряд ионов, радиационное охлаждение столба лазерной плазмы, созданного при облучении области шириной $d \sim 10^{-2} \text{ см}$, может быть описано в приближении оптически тонкой плазмы [13]. Активные среды экспериментально реализуемых коротковолновых лазеров создаются при таком значении d и в ряде случаев удовлетворяют вышеуказанным условиям на протяжении большей части времени своего существования. Отметим, что неприменимость приближения оптически тонкой плазмы, по-видимому, является фактором, способствующим реализации сверхлинейной зависимости скорости радиационного охлаждения от T_e . Это предположение основано на законе Стефана–Больцмана.

Скорость радиационных потерь оптически тонкой плазмы в расчете на один электрон и один ион обозначается через Q [13]. Для плазмы, находящейся в состоянии локального ионизационного равновесия, обозначим эту величину через Q_0 . Общая тенденция состоит в уменьшении Q_0 при увеличении T_e [13]. Зависимость $Q_0(T_e)$ имеет, однако, минимумы и максимумы, в отдельных температурных диапазонах она сверхлинейна, что особенно проявляется при высоких значениях n_e [13]. На ранних стадиях нагрева плазмы величина Q может значительно превосходить Q_0 [13]. Тем не менее, по-видимому, в температурном диапазоне, соответствующем генерации основного потока вынужденного излучения и некоторому предшествующему периоду времени, может быть достигнута сверхлинейная зависимость $Q(T_e)$.

Если плазма нагревается за счет теплопроводности и поток тепла близок к насыщению, то только сверхлинейная зависимость $Q(T_e)$ делает невозможным развитие неустойчивостей, связанных с радиационным охлаждением [14].

В мишени атомы примеси (или нескольких примесей), используемые для управления радиационными потерями, могут быть смешаны с атомами элемента, на ионах которого происходит усиление излучения или/и нанесены в виде покрытия [15]. В простейшем случае легирование активной среды, предназначенное для повышения ее однородности, будет однородно по координате x . В принципе возможно модулирование состава мишени, учитывающее воспроизведимые неоднородности I_p [2,8,11]. Этот метод также позволяет реализовать бегущую волну инверсии без внесения каких-либо изменений в систему фокусировки излучения накачки, предназначенную для одновременного облучения всей поверхности мишени [16,17].

При T_e , соответствующей минимуму $Q_e(T_e)$, значительная часть ионов находится в одном из состояний с замкнутыми электронными оболочками [13]. Это позволяет предположить, что при отсутствии специального легирования стабилизирующее влияние радиационных потерь может проявиться у лазеров со столкновительным возбуждением. Наибольший эффект возможен для лазеров, действующих на переходах $4d-4p$, что следует из сравнения значений Q_0 и температурных диапазонов возрастания этого параметра для различных элементов [13].

В экспериментах наблюдалось усиление вынужденного излучения на $4d-4p$ -переходах кобальтоподобных ионов [11,18]. Усиление на $3p-3s$ -переходах фтороподобных ионов, являющихся их аналогом, предсказано теоретически, но экспериментально не зарегистрировано [11,19]. В работах [4,5] отмечено, что для инверсии между уровнями таких ионов проблема однородности плазмы может иметь критическое значение. Возможно, что плазменный столб с однородностью, достаточной для усиления на $3p-3s$ -переходах фтороподобных ионов, будет создан при облучении мишени, состоящей из Y и Yb , нанесенных на полимерную пленку. Этот выбор обусловлен тем, что на основании данных работ [11,18-21] представляется возможным создание плазмы с высокой концентрацией фтороподобных ионов Y и никельподобных (а также, возможно, кобальтоподобных) ионов Yb . Так, на $3p-3s$ -переходах ($J = 2-1$) неоноподобного иона Y коэффициент усиления $\alpha = 4 \text{ см}^{-1}$ был реализован при $I_p = 1.4 \cdot 10^{14} \text{ Вт/см}^2$ [21] (строго говоря, здесь I_p обозначает интенсивность накачки, усредненную по некоторой области). При том же значении I_p коэффициент усиления $\alpha = 1.2 \text{ см}^{-1}$ наблюдался на одном из $4p-4s$ -переходов ($J = 0-1$) никельподобных ионов Yb (длительность импульса накачки была в два раза выше, чем в предыдущем случае) [20,21]. При $I_p = 3.5 \cdot 10^{14} \text{ Вт/см}^2$ усиление излучения происходило на $4d-4p$ -переходах ($J = 0-1$) как никель-, так и кобальтоподобных ионов Yb [11,18]. Другой возможный состав мишени — Ag и Au , но в отличие от предыдущего случая необходимое значение интенсивности накачки при таком выборе может оказаться неприемлемо высоким [6,11].

В спектрах $4d-4p$ -лазеров доминируют линии, соответствующие переходам $J = 0-1$ [11,18,20,21]. Согласно теории, для $3p-3s$ -лазеров наибольший коэффициент усиления также должен быть достигнут на одном из таких переходов, но в экспериментах он реализуется на пере-

ходах $J = 2-1$ [6,11,21–23]. Сравнительно большая продолжительность существования усиления на $3p-3s$ -переходах ($J = 2-1$) [22] затрудняет рассогласование усиления, обусловленное продольной неоднородностью активной среды. Однако для полного сравнения чувствительности усиления на различных переходах к такой неоднородности необходим учет и других факторов, в частности геометрических параметров области наибольшего усиления [4].

Заключение

По-видимому, зависимость скорости охлаждения (в частности, радиационного) от T_e является одним из основных факторов, определяющих однородность активной среды коротковолнового лазера. С этой зависимостью может быть связана сравнительно высокая неоднородность активных сред лазеров с рекомбинационной накачкой, создаваемых без использования в мишенях примесей, предназначенных для увеличения радиационных потерь [3,4,7]. Даже в случае использования такой примеси радиационные потери могут возрастать при падении T_e [12]. Целенаправленная реализация стабилизирующих эффектов, рассмотренных в данной работе, требует подбора состава мишени, ограничения максимального значения T_e (т.е. фактически ограничения максимального значения I_p) и, возможно, оптимизации зависимости $I_p(t)$. “Улучшение” зависимости скорости охлаждения от T_e в принципе может быть достигнуто и при охлаждении плазмы за счет теплопроводности (см., например, [7]).

Отметим, что в работе [24] сообщается о попытке компенсировать рефракцию коротковолнового излучения на поперечном градиенте n_e за счет кривизны мишени. В качестве возможной причины отсутствия в этом эксперименте заметного результата рассматривалась недостаточная однородность потока излучения накачки [24]. Вероятно, высокая однородность активной среды желательна и при компенсации рефракции с помощью мишени, состоящей из отдельных частей (см., например, [23]). Эффективная компенсация рефракции позволила бы достичь высокого коэффициента усиления на ранней стадии разлета плазмы, когда значения n_e и концентрации ионов велики (см. также [6,12,15]). Напомним, что большие значения n_e способствуют реализации сильной сверхлинейной зависимости $Q_0(T_e)$ [13].

Список литературы

- [1] Lee T.N., Molander W.A., Ford J.L., Elton R.C. // Rev. Sci. Instrum. 1986. Vol. 57. N 8. Pt 2. P. 2052–2054.
- [2] Eder D.C., Rosen M.D., Lee R.W. et al. // J. Opt. Soc. Am. B. 1987. Vol. 4. N 12. P. 1949–1953.
- [3] Jamelot G., Carillon A., Klisnick A., Jaegle P. // Appl. Phys. B. 1990. Vol. 50. P. 239–246.
- [4] Kieffer J.C., Chaker M., Pepin H. et al. // Opt. Comm. 1991. Vol. 84. N 3,4. P. 208–213.
- [5] Kieffer J.C., Chaker M., Pepin H. et al. // Inst. Phys. Conf. Ser. 1991. N 116. P. 347–350.
- [6] Fields D.J., Walling R.S., Shimkaveg G.M. et al. // Phys. Rev. A. 1992. Vol. 46. N 3. P. 1606–1609.
- [7] Jamelot G., Carillon A., Dhez P. et al. // Inst. Phys. Conf. Ser. 1992. N 125. P. 89–95.

- [8] Rus B., Zeitoun P., Carillon A. et al. // Inst. Phys. Conf. Ser. 1992. N 125. P. 361–366.
 - [9] Nantel M., Kieffer J.C., Pepin H. et al. // Inhomogeneity Issues in Germanium X-Ray Laser Plasma. Inst. Phys. Conf. Ser. 1992. N 125.
 - [10] La Fontaine B., Dunn J., Baldis H.A. et al. // Phys. Rev. E. 1993. Vol. 47. N 1. P. 583–590.
 - [11] MacGowan B.J., Da Silva L.B., Fields D.J. et al. // Phys. Fluids B. 1992. Vol. 4. N 7. P. 2326–2337.
 - [12] Keane C. and Suckewer S. // J. Opt. Soc. Am. B. 1991. Vol. 8. N 2. P. 201–211.
 - [13] Виноградов А.В., Шляпцев В.Н. // Квантовая электрон. 1987. Т. 14. № 1. С. 5–26.
 - [14] Evans R.G. // J. Phys. D. 1981. Vol. 14. N 10. P. L173–L177.
 - [15] Seely J.F., Brown C.M., Feldman U. et al. // Opt. Comm. 1985. Vol. 54. N 5. P. 289–294.
 - [16] Шматов М.Л. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. Вып. 18. С. 37–42.
 - [17] Shmatov M.L. // Preprint of A.F. Ioffe Phys. Techn. Institute. 1993. N 1604.
 - [18] MacGowan B.J., Da Silva L.B., Fields D.J. et al. // Phys. Rev. Lett. 1990. Vol. 65. N 19. P. 2374–2377.
 - [19] Hagelstein P.L. // Phys. Rev. A. 1986. Vol. 34. N 2. P. 924–942.
 - [20] MacGowan B.J., Maxon S., Keane C.J. et al. // J. Opt. Soc. Am. B. 1988. Vol. 5. N 9. P. 1858–1863.
 - [21] Keane C.J., Ceglio N.M., MacGowan B.J. et al. // J. Phys. B. 1989. Vol. 22. N 21. P. 3343–3362.
 - [22] London R.A., Rosen M.D., Maxon S.M. et al. // J. Phys. B. 1989. Vol. 22. N 21. P. 3363–3376.
 - [23] Carillon A., Chen H.Z., Dhez P. et al. // Phys. Rev. Lett. 1992. Vol. 68. N 19. P. 2917–2920.
 - [24] Kato Y., Azuma H., Murai K. et al. // ILE Research Report ILE 9010. P. 1990.
-